科学研究費補助金研究成果報告書

機関番号:14301 研究種目: 特定領域研究 研究期間:2007~2011 課題番号:19054010 研究課題名(和文)新規ナノプローブ計測法によるカーボンナノチューブの電気・力学物性評価 研究課題名(英文) Novel Nanoprobe Method for Investigating of Electrical and Mechanical Properties of Carbon Nanotubes

山田 啓文(YAMADA HIROFUMI) 京都大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:40283626

研究成果の概要(和文):

カーボンナノチューブ(CNT)デバイスにおける動作機構解析のためには、動作状態にある CNT の電気・機械特性評価が本質的に重要となる。本研究では、動作状態にある CNT デバイスの局 所領域における特性解析に向けて、AFM をベースとする新規高分解能ナノプローブ電気計測法 の開発を行い、欠陥評価に有効な各点ストロボ走査型ゲート顕微鏡や周辺電荷の影響を受けな い電位測定を可能とする高周波静電気力顕微鏡を開発した。

研究成果の概要(英文):

Nanometer-scale investigations of the electrical characteristics of carbon nanotube (CNT) devices in operation are essentially important for understanding of electrical conduction mechanisms in the devices. We have developed novel high-resolution nanoprobe techniques based on atomic force microscopy such as point-by-point stroboscopic scanning gate microscopy capable of visualizing potential barriers including channel defects and high-frequency electric force microscopy which allows us to measure precise local surface potentials without local charge effects.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2007 年度	14,200,000	0	14,200,000
2008 年度	16,200,000	0	16,200,000
2009 年度	17,800,000	0	17,800,000
2010 年度	17,700,000	0	17,700,000
2011 年度	11,500,000	0	11,500,000
総計	77,400,000	0	77,400,000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎、薄膜・表面界面物性 キーワード:カーボンナノチューブ、原子間力顕微鏡(AFM)、ケルビンプローブ AFM 周波数変調(FM)検出法、高分解能マルチプローブ AFM

1. 研究開始当初の背景

カーボンナノチューブ(CNT)デバイス開発 にあたっては、その動作機構の解析は必須で あり、動作状態にある CNT の電気・機械特 性を評価することは本質的に重要となる。原 子間力顕微鏡(AFM)は、対象試料に対する制 限のない高分解能構造評価法であり、さらに、 ケルビンプローブ AFM(KFM)など、派生する 多様な機能物性評価法による幅広い応用も 可能である。しかしながら、CNT デバイスは 絶縁体を含むさまざまな材料から構成され るため、その評価法は多様な材料に対応する 必要がある。例えば、通常の KFM 測定では、 CNT 周囲のトラップ電荷に起因する背景電 場の影響により、CNT の正確な電位測定が困 難となり、動作状態の解析は定性的な議論に とどまっていた。

2. 研究の目的

本研究課題では、周波数変調検出方式の原 子間力顕微鏡(FM-AFM)法など先進ダイナ ミックモードナノプローブ法に基づく、新規 高分解能ナノプローブ電気・力学計測法を開 発し、動作状態にある CNT の電気・力学特 性の解析評価技術を確立することを目的と する。具体的には、(1) FM-AFM など先進ダ イナミックモードナノプローブ法に基づく 高分解能ナノプローブ電気物性評価、(2) ナ ノチューブの電気-力学応答計測、(3)動的な 物性評価のための高分解能マルチプローブ AFM の開発を目標とする。

研究の方法

前項に記載した個々の目標についての具 体的な研究方法は以下のとおりである。

(1) FM-AFM など先進ダイナミックモードナ ノプローブ法に基づく高分解能ナノプロー ブ電気物性計測:高感度 FM-AFM 法に基づく KFM(FM-KFM)や AFM ポテンショメトリ (FM-SPoM)を確立する。絶縁体基板上にある CNT の電位測定は背景力となる静電気力に 大きく影響されるため、この背景力を補償し、 試料だけの電位情報を抽出する新規 KFM を 開発する。さらに、低雑音 FM-AFM の開発に より高分解能イメージングを実現し、カイラ リティ・構造欠陥の直接観察を行う。

(2) ナノチューブの電気-力学応答計測:支持 部を電極とする、CNTの機械的梁構造を作製 し、線形/せん断応力に対する電気応答を計 測することで、CNTの電気力学物性を評価す る。さらに、せん断応力による CNTのカイ ラリティ変化と電気応答との関連を分析す る。

(3) 動的な物性評価のための高分解能マルチ プローブ AFM の開発: CNT 上の1点で電気 的/力学的変調を加え、異なる場所における その応答(空間相関)を同時に計測する高分解 能マルチプローブ AFM を開発する。

4. 研究成果

(1) CNT チャネル上の欠陥・電位障壁の可 視化

走査ゲート顕微鏡(SGM)は、AFM の探針を 局所ゲートとして、トランジスタのチャネル 電流をマッピングする手法であり、CNT チャ ネル中の欠陥や電位障壁の位置を可視化で きる手法として注目されている。従来、SGM 動作中の探針ゲートバイアスは固定され、静 電気力によるプローブ動作への影響を避け るため、試料から比較的離れた状態で走査す ることが多く、総じて分解能が低く、異なる バイアスでの SGM 像を得るには、別途フレ ーム走査する必要であった。われわれは、試

料上の各 pixel において、探針-試料距離測定 (表面形状測定)と探針ゲート電圧の印加・チ ャネル電流測定とを時分割して繰り返す、各 点走査ゲート顕微鏡(P-SGM)を開発した。 P-SGM では、至近距離で探針ゲート電圧を加 えるため、空間分解能が改善する。さらに、 図1(a)のように各 pixel で探針電圧を掃引し て電流データを保存し、走査後に各ゲート電 圧における SGM 像を再構成する、ストロボ 走査型ゲート顕微鏡 (stroboscopic SGM: S-SGM)を開発した。S-SGM では、P-SGM の 利点に加え、一回の走査でさまざまな探針ゲ ート電圧に対する SGM 像を取得でき、動的 なヒステリシスの影響の評価や探針-試料間 距離のドリフトなどの影響も抑制すること も可能となる。S-SGM を用いて、両極性を示 した CN-FET 試料を真空中(< 10⁻³ Pa)で測定 した結果、その局所ゲート応答変化から、上 部電極端で、単調な依存性をもつ電流変化が 生じており、ホールに対する Schottky 障壁が 電極端にあると解釈された。また、チャネル 中の局所領域で、探針ゲート電圧の正負に対 してともに電流変化が観測され、両極性的な 欠陥がこの位置に存在することが判明した。





(2) 高精度表面電位測定手法の開発 KFM は、高空間分解能を有する、定量的な電 位分布測定法として広く用いられているが、 AFM 探針の曲率半径よりも小さな測定試料 に対しては、試料周辺からの静電気力(背景 力)の影響を受けて定量性が失われる傾向に ある。従って、一般に探針曲率半径よりも細 い CNT の正確な表面電位を測定することは 容易でない。そこで、試料周辺の空間的静電





気力分布を測定することで、これらの背景力 を補償し、純粋に試料の電位情報を得ること を試みている。背景力が探針-試料間の距離に 依存して変化することに着目し、探針を試料 表面に沿って単純に2次元走査するのでは なく、3次元空間的に電位情報と探針-試料間 の容量の情報を取得する。得られた測定結果 とモデル計算を対応させることで正しい電 位を導出することを目指した。測定の概念図 を図2(a)に示す。上記情報は、実際にはバイ アスフォースカーブを3次元的に取得する ことで得られる。バイアスフォースカーブと は、探針-試料間のバイアス電圧(V)に対して、 静電気力を反映するカンチレバーの共振周 波数シフト(Δf)をプロットした曲線($\Delta f - V$

カーブ)であり、静電容量依存性に似て V² に 比例する。その極値となる電圧は KFM で測 定される表面電位 V_s に相当し、 V^2 の係数 α は 探針-試料間の静電容量に比例する。モデル計 算では、試料系を図2(b)のようにモデル化し、 その各構成要素である探針と CNT・シリコン 基板・寄生容量を生む外的要因(モデルと現実 の差異も含む)間の静電容量をそれぞれ C_{1t}, C_{2t} , C_{3t} とし、各構成要素が有する電位を V_t (探針)、V₁(CNT)、V₂(シリコン基板)、V₃(外 的要因)と定義する。このモデルの下、探針が CNT の真上にあるときに観測される表面電 位 V、を、探針-試料間バイアスによって生じ る周波数シフトから理論的に解析すると、V、 と係数αに関する関係式が得られる。この関 係式において、V、およびαの距離依存を観測 対象としていることや、係数 α が C_{1t} , C_{2t} , C_{3t} の和の関数になることを考慮すると、直接測 定からは得られない C_{1t}, C_{2t}の探針位置依存 性さえ分かれば、V1, V2, V3を変数として上記 関係式にフィッティングすることで、真値に 相当する CNT の補正電位 V1 が求まることが 導かれる。ここで C_{1t}, C_{2t}の依存性は、測定系 モデルを構成する各要素サイズに典型値を 採用して有限要素計算し、シミュレーション から得ることで求められた。図2(c)は、実測 した結果をモデル計算によって補正した-例である。まず、測定電位とは、CNT 全体に 外部からバイアス電圧 VCNT を加えて、チャネ ル中央付近を横切る上空でバイアスフォー スカーブ測定を行い、CNT の最近接点で得た V,のことであるが、V,は背景力の影響を受け ているため、加えた V_{CNT}よりもおよそ 10% 程度低い値として測定されていることが分 かる。一方、モデル計算によって得られた補 正電位 V_1 は、加えた V_{CNT} の変化によく追随 する結果がえられた。この結果より探針の表 面電位の実測値から CNT の仕事関数を換算 すると 4.94 eV と求まった。

前段では、3次元バイアスフォースカーブ 測定とモデル計算を比較することで、背景力 の影響を除去し、試料の表面電位を求めた。 一方で、そもそも背景力の影響を受けにくい 測定法の開発も重要となる。われわれは、 CNT チャネルの電位変調時のトラップ電荷 の再分布は、高速な電位変調には追従できな いことに着目し、チャネル以外の静電気力の 寄与を除去して CNT チャネルの電位プロフ ァイルを測定できる、新しい静電気力顕微鏡 法(EFM)について検討した。CNT が架橋し た電極対のうち片方の電極およびカンチレ バー探針を接地し、もう一方の電極に周波数 fmの交流電圧を印加すると、静電気力は電圧 の2乗に比例することから、カンチレバーに は探針直下の CNT チャネルの各位置での変 調電圧振幅に比例した 2fm 成分の静電気力が はたらく。このとき、周波数 fm が電荷の再分

布より十分に高速であれば、トラップ電荷か らの静電気力の寄与を排除して、CNT チャネ ルにおける交流電圧印加時の電圧降下プロ ファイルを測定することが可能となる。さら に、探針-試料間距離制御には周波数変調 (FM)検出方式を用い、カンチレバーの共振 周波数シフトにおける 2fmの周波数変調成分 を検出することで、FM 検出回路探針と探針 直下の CNT 部位との間にはたらく静電気力 を選択的に測定できる、FM-EFM を実現した。 一方、CNT に印加する交流電圧として、二つ の異なる周波数成分 (f_1 および $f_2 = f_1 + f_m$)を 有する交流電圧を印加し、その周波数差fm成 分の周波数変調成分を検出する高周波 FM-EFM (FM-HF-EFM) でも同様の測定を行 うことできる。FM-HF-EFM では、fm を FM 検出器の帯域内の周波数 (~1 kHz) に保った ままで、印加周波数を幅広く選択することが でき、トラップ電荷の再分布の影響やチャネ ルの電位プロファイルの周波数依存性を評 価することが可能である。

(3) デュアルプローブ原子間力顕微鏡の開発 AFM 探針(プローブ)が複数あれば、電極パ ターンを作製することなく CNT の電気・機 械的な各種測定が行えるため、他の物性計測 との連携など柔軟性の高い測定が可能にな る。しかしながら、このような複数のプロー ブを有するマルチプローブ AFM は、その装 置構成が複雑なことから実用的な段階には 至っていない。本研究では、変位(力)検出系 には感度の点で優れている光てこ法を用い、 2本のプローブを独立に3軸駆動可能な高 分解能デュアルプローブ AFM (DP-AFM)を 開発してきた。2本のプローブを独立に駆動 するため、限られた空間の中で各パーツの配 置を最適化し、真空中で動作可能な装置を完 成させた。この開発した縦入射光てこ DP-AFMの基本装置性能と CNT 電気計測の 適用に向けた課題を探るため、まずテスト試 料として、絶縁性基板上に孤立堆積した有機 半導体単結晶(α-6T)の電気特性評価を真空環 境で試み、真空環境にすることで良好な FET 特性を任意のプローブ配置で測定できるこ とを確認した。また、課題であった温度ドリ フト低減や真空度の向上も既に対策を施し、 良好な測定が可能な状態となった。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

 M. Ito, Y. Hosokawa, R. Nishi, and <u>Y.</u> <u>Miyato, K. Kobayashi</u>, K. Matsushige and <u>H.</u> <u>Yamada</u>: "Effect of Trapped Charges on Local Potential Measurement of Carbon Nanotubes Using Frequency-Modulation Kelvin-Probe Force Microscopy", e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 9, 査読有, pp. 210-214, DOI: 10.1380/ejssnt.2011.210 (2011).

(2) E. Tsunemi, <u>K. Kobayashi</u>, K. Matsushige, and <u>H. Yamada</u>: "Development of dual-probe atomic force microscopy system using optical beam deflection sensors with obliquely incident laser beams", Rev. Sci. Instrum., 82, 査読有, 033708, doi:10.1063/1.3534830 (2011).

- (3) K. Kaneko, <u>Y. Miyato, K. Kobayashi</u>, K. Matsushige, and <u>H. Yamada</u>: "Position Control and Electrical Characterization of Single-Walled Carbon Nanotubes Debundled by Density Gradient Ultracentrifugation", Jpn. J. Appl. Phys., 49, 查読有, 02BD04, DOI: 10.1143/JJAP.49.02BD04 (2010).
- (4) Y. Miyato, K. Kobayashi, K. Matsushige, and <u>H. Yamada</u>: "Surface Potential Investigation of Carbon Nanotube Field-Effect Transistor by Point-by-Point Atomic Force Microscope Potentiometry", Jpn. J. Appl. Phys., 49, 査読 有, 02BD03, DOI: 10.1143/JJAP.49.02BD03 (2010).
- (5) T. Nishio, <u>Y. Miyato, K. Kobayashi</u>, K. Matsushige and <u>H. Yamada</u>: "The effect of local polarized domains of ferroelectric P(VDF/TrFE) copolymer thin film on a carbon nanotube field-effect transistor", Nanotechnology, 19, 査読有, 035202, stacks.iop.org/Nano/19/035202 (2008).
- (6) T. Nishio, <u>Y. Miyato, K. Kobayashi</u>, K. Matsushige and <u>H. Yamada</u>: "Piezoresistive properties of carbon nanotubes under radial force investigated by atomic force microscopy", Appl. Phys. Lett., 92, 査読有, 063117, DOI: 10.1063/1.2857480 (2008).

〔学会発表〕(計5件)

- (1) M. Ito, <u>K. Kobayashi, Y. Miyato</u>, K. Matsushige, <u>H. Yamada</u>: "High-resolution surface potential mapping on single-walled carbon nanotubes using frequency-modulation high-frequency electrostatic force microscopy", The 14th International Conference on Non-Contact Atomic Force Microscopy (NC-AFM 2011), 2011 年 9 月 20 日 (リンダウ,ドイツ).
- (2) R. Nishi, <u>Y. Miyato</u>, N. Oyabu, <u>K. Kobayashi</u>, K. Matsushige, <u>H. Yamada</u>: "3-D potential mapping on CN-FETs by atomic force microscopy", PacifiChem 2010, 2010年12月

17日 (ハワイ,アメリカ合衆国).

- (3) Y. Miyato, K. Kobayashi, K. Matsushige, H. Yamada: "AFM Characterization of Carbon Nanotube FETs Fabricated by Dielectrophoresis Method Using Density Gradient Ultracentrifugation Process", 2009 Materials Research Society Fall Meeting, 2009 年 12 月 1 日 (ボストン, アメリカ合 衆国).
- (4) <u>Y. Miyato, K. Kobayashi</u>, K. Matsushige, <u>H.</u> <u>Yamada</u>: "Surface Potential Measurements of CN-FETs by AFM Potentiometory", 9th International Conference of the Science and Application of Nanotubes, 2008 年 7 月 1 日 (モンペリエ、フランス).
- (5) Y. Miyato, K. Kobayashi, K. Matsushige and <u>H. Yamada</u>: "Surface Potential Mapping of Carbon Nanotube Field Effect Transistor by Kelvin Probe Force Microscopy and AFM Potentiometry", 2007 Materials Research Society Fall Meeting, 2007 年 11 月 30 日 (ボ ストン, アメリカ合衆国).

〔図書〕(計1件)

(1) <u>宮戸祐治、山田啓文</u>、松重和美,シーエムシー出版,第1章 走査プローブ技術-分子エレクトロニクスを縁の下から支える走査プローブ顕微鏡-,「分子エレクトロニクスの基盤技術と将来展望」(松重和美・田中一義・和田恭雄 監修), pp. 3-16 (2009)

〔産業財産権〕

○取得状況(計1件)

名称:分子デバイス及びその製造方法 発明者:<u>宮戸祐治</u>,<u>小林圭</u>,<u>山田啓文</u>,松重 和美 権利者:国立大学法人京都大学 種類:特許 番号:特許第4714881号 取得年月日:2011年8月11日 国内外の別:国内

〔その他〕 ホームページ等 http://piezo.kuee.kyoto-u.ac.jp/jp/research/cnt

研究組織
(1)研究代表者
山田 啓文(YAMADA HIROFUMI)
京都大学・工学研究科・准教授
研究者番号:40283626

(2)研究分担者
小林 圭 (KOBAYASHI KEI)
京都大学・産官学連携本部・助教
研究者番号:40335211

野田 啓 (NODA KEI) 京都大学・工学研究科・助教 研究者番号: 30372569

宮戸 祐治 (MIYATO YUJI) 大阪大学・基礎工学研究科・助教 研究者番号: 80512780